

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第1区分
 【発行日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【公開番号】特開2005-22919(P2005-22919A)
 【公開日】平成17年1月27日(2005.1.27)
 【年通号数】公開・登録公報2005-004
 【出願番号】特願2003-189631(P2003-189631)
 【国際特許分類】

C 0 1 B 25/238 (2006.01)

C 0 1 B 25/20 (2006.01)

H 0 1 L 21/308 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 25/238

C 0 1 B 25/20

H 0 1 L 21/308 E

【手続補正書】

【提出日】平成17年10月3日(2005.10.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 H_3PO_4 の濃度を85重量%に換算したときの不純物含量として、Sbが200ppb以下であり且つ硫化物イオンが200ppb以下であることを特徴とする高純度リン酸。

【請求項2】 粗リン酸に、硫化水素ガスを過剰に吹きこみ、該粗リン酸に含まれている不純物金属を硫化物として沈殿させる第1工程と、第1工程で得られたリン酸を濾過する第2工程と、第2工程終了後にリン酸と空気とを除去塔内で接触させて、リン酸中に含まれる硫化水素ガスを除去する第3工程とを行い、且つ第1及び第2の工程を59以下で行うことで得られる請求項1記載の高純度リン酸。

【請求項3】 前記粗リン酸は、黄リンを燃焼させて五酸化二リンをガス生成させた後、該ガスを水和させて得られる乾式リン酸である請求項1又は2記載の高純度リン酸。

【請求項4】 電子デバイスのエッチングに用いられる請求項1～3の何れかに記載の高純度リン酸。

【請求項5】 不純物金属を含む粗リン酸に硫化水素ガスを過剰に吹き込み、該粗リン酸に含まれている不純物金属を硫化物として沈殿させる第1工程と、第1工程で得られたリン酸を濾過する第2工程と、第2工程終了後にリン酸と空気とを除去塔内で接触させて、リン酸中に含まれる硫化水素ガスを除去する第3工程とを含み、且つ第1及び第2の工程を59以下で行うことを特徴とする高純度リン酸の製造方法。

【請求項6】 第1工程と第2工程との間に熟成工程を行う請求項5記載の高純度リン酸の製造方法。

【請求項7】 第1工程は、粗リン酸と硫化水素ガスとを、充填物を充填した吸収塔内で接触させて行う請求項5又は6記載の高純度リン酸の製造方法。

【請求項8】 第3工程は、リン酸と空気とを、充填物を充填した除去塔内で接触させて行う請求項5～7の何れかに記載の高純度リン酸の製造方法。

【請求項9】 前記不純物金属を含む粗リン酸は、黄リンを燃焼させて五酸化二リンをガス生成させた後、該ガスを水和させて得られる乾式リン酸である請求項5～8の何れ

かに記載の高純度リン酸の製造方法。